(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. August 2002 (01.08.2002)

PCT

(72) Erfinder; und

haching (DE).

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/059392 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 16/02, C01B 31/02, H01L 21/3205

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KREUPL, Franz

[DE/DE]; Müllerstr. 43, 80469 München (DE). HÖN-

LEIN, Wolfgang [DE/DE]; Parkstr. 8a, 82008 Unter-

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/00194

C23C 16/26.

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. Januar 2002 (22.01.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

DE

(74) Anwalt: VIERING, JENTSCHURA & PARTNER; Steinsdorfstrasse 6, 80538 München (DE).

(30) Angaben zur Priorität:

101 03 340.0

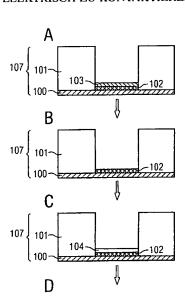
25. Januar 2001 (25.01.2001)

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR GROWING CARBON NANOTUBES ABOVE A BASE THAT IS TO BE ELECTRICALLY CONTACTED AND A COMPONENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM WACHSEN VON KOHLENSTOFF-NANORÖHREN OBERHALB EINER ELEKTRISCH ZU KONTAKTIERENDEN UNTERLAGE SOWIE BAUELEMENT



104

104

102

WO 02/059392 A1

107 | 101

107 101

l 100

100

E

- (57) Abstract: The invention relates to a method for growing carbon nanotubes above a base that is to be electrically contacted. According to said method, at least one metal, which is catalytically active in the growth of carbon nanotubes is applied above the predetermined area of the base that is to be contacted, by means of an electrodeless deposition method and carbon nanotubes are grown on the catalytically active metal.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb einer elektrisch zu kontaktierenden Unterlage, bei dem zumindest ein für den Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren katalytisch aktives Metall oberhalb des vorgegebenen Bereichs der zu kontaktierenden Unterlage mittels eines elektrolosen Abscheideverfahrens aufgebracht wird, und bei dem Kohlenstoff-Nanoröhren auf dem katalytisch aktiven Metall gewachsen werden.

WO 02/059392 A1



(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{ir}\) \(\text{Anderungen der Anspr\(\text{uch}\) che geltenden
 Frist; Ver\(\text{offentlichung wird wiederholt, falls \text{Anderungen}\)
 eintreffen

1

Beschreibung

Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb einer elektrisch zu kontaktierenden Unterlage sowie Bauelement

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb einer elektrisch zu kontaktierenden Unterlage sowie ein Bauelement.

- 10 Um die hohe elektrische Leitfähigkeit von KohlenstoffNanoröhren zum Beispiel bei der Anwendung solcher KohlenstoffNanoröhren als Via-Interconnect in der Mikroelektronik
 auszunützen, müssen auf die zu kontaktierende Unterlage eines
 mikroelektronischen Schaltkreises, welche in den meisten
- 15 Fällen eine Leiterbahn ist, metallische Katalysatoren aufgebracht werden, so dass auf diesen mit Hilfe von beispielsweise einer Abscheidung aus der Gasphase (CVD-Verfahren) Kohlenstoff-Nanoröhren aufgewachsen werden können. Hierzu muss die zu kontaktierende Unterlage durch eine
- 20 Bedeckung der Oberfläche der Unterlage mit einem Katalysatormaterial während oder vor der Strukturierung versehen werden, das geeignet ist, um das Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren zu katalysieren.
- 25 Es gibt im Stand der Technik einige bekannte Verfahren zum Versehen der Oberfläche einer zu kontaktierenden Unterlage eines mikroelektronischen Schaltkreises mit einem Metall.

 Diese bekannte Verfahren sind jedoch meist mit erheblichen Nachteilen verbunden, die entweder das Aufbringen und/oder das anschließende Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren erschweren.

Bei einer Damascene-Strukturierung muss zum Beispiel die Abscheidung des Materials der zu kontaktierenden Unterlage des

2

mikroelektronischen Schaltkreises so gestoppt werden, dass nach dem Abscheiden des Katalysatormaterials sowie nach dem CMP-Strukturierungsverfahren (CMP = Chemical Mechanical Polishing) noch genügend oder ausreichend Katalysatormaterial auf der Oberfläche der zu kontaktierenden Unterlage zurückbleibt, um ein katalytisches Aufwachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren zu bewirken.

5

30

Wird die Trockenätz-Technik zum Strukturieren einer zu

kontaktierenden Unterlage eines mikroelektronischen
Schaltkreises verwendet, so wird beim anschließenden Veraschen
des Lacks die Katalysatoroberfläche oxidiert und somit
unbrauchbar gemacht.

15 Weiterhin könnte durch einfaches Aufsputtern oder Aufdampfen des Katalysatormaterials dieses Katalysatormaterial auf die zu kontaktierende Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises abgeschieden werden. Dadurch wird jedoch die ganze Oberfläche des mikroelektronischen Schaltkreises, d.h. nicht nur die Oberfläche der zu kontaktierenden Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises mit Katalysatormaterial bedeckt. Des weiteren bekommt man hierdurch eine Bedeckung der Via-Seitenwände, so dass bei dem anschliessenden Aufwachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren diese überall, d.h. nicht nur auf den als zu kontaktierende Unterlage anzusehenden Via-Boden mit seiner Leiterbahn, aufwachsen.

Wird das Katalysatormaterial auf die zu kontaktierende
Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises galvanisch
aufgebracht, so muss jede einzelne zu kontaktierende Unterlage
mit einer Elektrode kontaktiert werden, um dann in einem
Elektrolyten durch Stromfluß diese zu kontaktierende Unterlage
mit Katalysatormaterial zu bedecken. Dieses Verfahren ist an

3

sich zeit- und kostenaufwendig und erschwert das Herstellungsverfahren erheblich.

- Ferner ist in [1] ein Niedertemperatur-Verfahren zum Synthetisieren von Kohlenstoff-Nanoröhren unter Verwendung eines Abscheideverfahrens aus der Gasphase (Chemical Vapour Deposition-Verfahren, CVD-Verfahren) beschrieben.
- Aus [2] ist ein Feldemitter mit einer Schicht aus Kohlenstoff10 Nanoröhren bekannt, welcher eine hohe Stromdichte selbst bei
 einer niedrigen elektrischen Spannung bereitstellt.

Andere Feldemitter-Vorrichtungen mit Kohlenstoff-Nanoröhren sind in [3], [4] und [5] beschrieben.

15

25

30.

Gemäß [2], [3], [4] und [5] werden die Kohlenstoff-Nanoröhren ebenfalls unter Verwendung eines CVD-Verfahrens gebildet.

Somit liegt der Erfindung das Problem zugrunde, ein
verbessertes Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren
auf einer zu kontaktierenden Unterlage bereitzustellen.

Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch Bereitstellen eines Verfahrens zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb eines vorgegebenen Bereichs einer zu kontaktierenden Unterlage,

- bei dem zumindest ein für den Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren katalytisch aktives Metall oberhalb des vorgegebenen Bereichs der zu kontaktierenden Unterlage mittels eines elektrolosen Abscheideverfahrens aufgebracht wird, und
- bei dem Kohlenstoff-Nanoröhren auf dem katalytisch aktiven Metall gewachsen werden.

4

Das Problem wird weiterhin durch ein Bauelement gelöst, das Kohlenstoff-Nanoröhren, die gemäß dem obenstehenden erfindungsgemäßen Verfahren gewachsen sind, aufweist.

5 Das erfindungsgemäße Verfahren bringt gegenüber dem Stand der Technik einige wichtige Vorteile mit sich.

Zum Beispiel kann im Gegensatz zum Damascene-Verfahren eine zu kontaktierende Unterlage eines mikroelektronischen

- Schaltkreises, beispielsweise eine Leiterbahn eines mikroelektronischen Schaltkreises, die am Boden eines geätzten Vias liegt, noch vor dem Aufbringen des für den Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren katalytisch aktiven Metalls, fertig hergestellt werden (einschließlich CMP-
- 15 Strukturierungsverfahren), ohne das Herstellungsverfahren zwischenzeitlich noch vor dem Aufbringen des katalytisch aktiven Metalls unterbrechen zu müssen.

Weiterhin kann beim erfindungsgemäßen Verfahren von einem anschließenden Veraschungsschritt abgesehen werden, so dass das aufgebrachte, katalytisch aktive Metall nicht durch Oxidation beschädigt und unbrauchbar gemacht wird.

Ein weiterer, sehr wichtiger Vorteil des erfindungsgemäßen

Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik ist darin zu sehen,
dass bei ihm das katalytisch aktive Metall ausschließlich an
denjenigen Stellen aufgebracht wird, auf denen es zum späteren
Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren erforderlich ist. Dies
steht im deutlichen Gegensatz zu herkömmlichen Aufsputteroder Aufdampfverfahren, bei dem das aufzubringende
katalytische Metall nicht nur auf die zu kontaktierende
Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises, sondern auf
die gesamte Oberfläche des die zu kontaktierende Unterlage

5

enthaltenden, mikroelektronischen Schaltkreises aufgebracht wird.

Des weiteren sind beim erfindungsgemäßen Verfahren keine Elektroden erforderlich, da das erfindungsgemäße Verfahren auf einen inneren statt auf einen von außen eingespeisten Stromfluß beruht.

5

Schließlich ermöglicht das chemische Abscheiden in Kombination Zusammenhang mit dem Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren, dass 10 eine sehr gleichmäßige Dicke der aufzubringenden Schicht aus katalytisch aktivem Metall erzielt werden kann. Des weiteren kann diese Dicke an sich in einfacher Weise durch Einstellen der Konzentration des katalytisch aktiven Metalls bzw. des Vorläufers des katalytisch aktiven Metalls in der Lösung 15 und/oder durch Einstellen der Reaktionszeit den Anforderungen des Einzelfalls angepasst werden. So wird gegenüber dem Stand der Technik gewährleistet, dass das zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren vorgesehene, katalytisch aktive Metall in einer diesem Zweck dienlichen Dicke und Beschaffenheit 20 oberhalb des zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren vorgesehenen Bereichs aufgebracht werden kann.

Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung wird zunächst
eine erste Schicht direkt auf den vorgegebenen Bereich der zu
kontaktierenden Unterlage des mikroelektronischen
Schaltkreises abgeschieden und anschließend eine zweite
Schicht mit dem katalytisch aktiven Metall direkt auf die
erste Schicht abgeschieden. Vorzugsweise weist die erste
30 Schicht Metallatome auf, und kann für den Fall, dass die
zweite Schicht mit dem katalytisch aktiven Metall schlecht auf
der zu kontaktierenden Unterlage haftet, diese Haftung
fördern. In diesem Fall ist es erforderlich, dass die erste

6

Schicht, die direkt auf den vorgegebenen Bereich der zu kontaktierenden Unterlage abgeschieden wird, elektrisch leitfähig ist. Zu diesem Zweck weist diese erste Schicht vorzugsweise Metallatome auf.

5

10

15

20

25

30

Erfindungsgemäß kann das Wachsen der Kohlenstoff-Nanoröhren auf dem katalytisch aktiven Metall oberhalb des vorgegebenen Bereichs der zu kontaktierenden Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises mittels eines Abscheideverfahrens aus der Gasphase erfolgen.

Wie oben bereits angedeutet kann beim erfindungsgemäßen Verfahren die zu kontaktierende Unterlage eine Leiterbahn eines mikroelektronischen Schaltkreises sein. Diese Leiterbahn kann an sich Kupfer oder Aluminium aufweisen.

Zum Fördern sowohl der Haftung als auch des elektrischen Kontakts zwischen der ersten Schicht, die direkt auf der zu kontaktierenden Unterlage liegt, und der zu kontaktierenden Unterlage selbst kann vor dem Aufbringen der ersten Schicht auf die zu kontaktierende Unterlage eventuell vorhandenes Metalloxid auf der Oberfläche der zu kontaktierenden Unterlage entfernt werden. Ein solches Entfernen kann erfindungsgemäß beispielsweise mit Wasserstoffplasma, d.h. reduzierend, oder mit Säure erfolgen.

Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung besteht die erste Schicht, die direkt auf den vorgegebenen Bereich der zu kontaktierenden Unterlage des mikroelektronischen Schaltkreises abgeschieden wird, aus PdCl₂. Diese Schicht aus PdCl₂ kann beispielsweise dadurch aufgebracht werden, indem eine wässrige Lösung mit etwa:

• 0,25 g/l bis etwa 12,5 g/l $PdCl_2$,

7

- etwa 0,25 bis etwa 12,5 Vol.-%, 36% HCl und
- etwa 0 bis 20 Vol.-% Glyzerin/Ethanol

in Kontakt mit dem vorgegebenen Bereich der zu kontaktierenden Unterlage gebracht wird und anschließend mit 10 Vol.-% HCl und anschließend nochmals mit Wasser gespült wird.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann die zweite Metallschicht, die direkt auf der ersten Schicht aufgebracht wird, aus Nickel bestehen. Nickel ist in diesem Fall das zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren katalytisch aktive Metall. Das Nickel kann auf die erste Schicht aufgebracht werden, indem eine wässerige Lösung mit

- etwa 45 g/l NiCl₂,
- etwa 11 g/l NaOCl,
- 15 etwa 100 g/l Natriumcitrat und
 - etwa 50 g/l Ammoniumchlorid

in Kontakt mit der ersten Schicht gebracht wird und anschließend mit H_2O gespült wird. Hier ist das Natriumcitrat als das reduzierende Mittel anzusehen, das das Ni Cl_2 noch in der Lösung in die Reinmetallform reduziert, so dass dieses in Reinmetallform auf die erste Schicht abscheidet.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren dargestellt und wird im Weiteren näher erläutert.

25

20

Es zeigen

Figuren la bis le in schematischer Weise den Ablauf eines
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
mit einem im Querschnitt dargestellten Ausschnitts
eines mikroelektronischen Schaltkreises.

8

Fig.1a zeigt einen Querschnitt eines Ausschnitts eines mikroelektronischen Schaltkreises 107. Der mikroelektronische Schaltkreis 107 weist ein Substrat 100, eine Dielektrikumschicht 101 und eine als zu kontaktierende

5 Unterlage zu verstehende Leiterbahn 102 auf. Bei dem Fertigungszustand des mikroelektronischen Schaltkreises 107 in Fig.1a ist der Bereich des Dielektrikums 101, der oberhalb der Leiterbahn 102 liegt, beispielsweise mittels eines photolithographischen Ätzverfahrens bereits entfernt worden

10 (dieser Schritt ist dem gezeigten Verfahrensablauf vorgeschaltet und ist an sich nicht gezeigt). Des weiteren existiert auf der Oberfläche der Leiterbahn 102 in Fig.1a eine Metalloxidschicht 103, die aus dem Oxid des Metalls der Leiterbahn 102 gebildet ist.

- Fig.1b zeigt den Fertigungszustand des mikroelektronischen Schaltkreises 107, nachdem die Metalloxidschicht 103 oberhalb der Leiterbahn 102 entfernt worden ist. Dieses Entfernen kann beispielsweise unter stark reduzierenden Bedingungen erfolgen.

 Hierzu ist die Behandlung des mikroelektronischen Schaltkreises mit Wasserstoffplasma oder mit Säure, beispielsweise Mineralsäure, zum Entfernen der Oxidschicht 103 auf der Leiterbahn 102 geeignet.
- Fig.1c zeigt den Fertigungszustand des mikroelektronischen Schaltkreises 107, nachdem eine erste, als Primerschicht anzusehende Schicht 104 direkt auf der Leiterbahn 102 aufgebracht ist. Vorzugsweise besteht diese erste Schicht 104 auf der Leiterbahn 102 in diesem Ausführungsbeispiel aus PdCl₂. Die erste Schicht 104 kann durch Inkontaktbringen einer wässrigen Lösung enthaltend
 - etwa 0,25 g/l bis etwa 12,5 g/l PdCl₂,
 - etwa 0,25 bis etwa 12,5 Vol.-%, 36% HCl und

9

• etwa 0 bis etwa 20 Vol.-% Glyzerin/Ethanol mit der zu kontaktierenden Leiterbahn 102 und durch anschließendes Spülen mit 10 Vol.-% HCl und nochmaligem Spülen mit Wasser erfolgen.

5

10

15

- Fig.1d zeigt den Fertigungszustand des mikroelektronischen Schaltkreises 107, nachdem direkt auf die erste Schicht 104 eine zweite Schicht 105 mit dem katalytisch aktiven Metall aufgebracht worden ist. Vorzugsweise besteht diese zweite Schicht 105 aus Nickel, das zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren als katalytisch aktives Metall funktionieren kann. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann die zweite Schicht 105 aus Nickel direkt auf der ersten Schicht 104 aus PdCl₂ durch Inkontaktbringen einer wässrigen Lösung enthaltend
- etwa 45 g/l NiCl₂,
- etwa 11 g/l NaOCl,
- etwa 100 g/l Natriumcitrat und
- etwa 50 g/l Ammoniumchlorid
- mit der ersten Schicht 104 aus PdCl₂ und durch anschließendes Spülen mit H₂O aufgebracht werden. Das in der letztgenannten Lösung vorhandene NiCl₂ wird noch in der Lösung durch das Natriumcitrat zur Reinmetallform reduziert (Ni°), und das Nickel in Reinmetallform scheidet dann auf die erste Schicht 104 PdCl₂ ab.
 - Fig.1e zeigt den Fertigungsstand des mikroelektronischen Schaltkreises 107, bei welchem Kohlenstoff-Nanoröhren 106 auf der Oberfläche des katalytisch aktiven Metalls 105 gewachsen worden sind. Aufgrund der Tatsache, dass das katalytisch aktive Metall der zweiten Schicht 105, in diesem Ausführungsbeispiel Nickel, sich nur oberhalb der zu

10

kontaktierenden Leiterbahn 102 befindet, wachsen nur in diesem Bereich Kohlenstoff-Nanoröhren auf. So ermöglicht dieses Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im Endeffekt ein gezieltes Aufbringen von Kohlenstoff-Nanoröhren 106 auf einen bestimmten Bereich eines mikroelektronischen Schaltkreises 107, während alle anderen, nicht vorgegebenen Bereiche des mikroelektronischen Schaltkreises 107 von den Kohlenstoff-Nanoröhren 106 frei bleiben. Im Rahmen dieses Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, dass die Kohlenstoff-Nanoröhren 106 mittels eines Abscheideverfahrens aus der Gasphase (CVD-Verfahren) gewachsen werden.

In einem weiteren, den Schritt in **Fig.1e** anschließenden

Schritt ist es dann möglich, die Kohlenstoff-Nanoröhren 106
mit einem weiteren leitenden Körper in Kontakt zu bringen, um
diesen weiteren leitenden Körper mit der Leiterbahn 102 über
die Kohlenstoff-Nanoröhren 106, die zweite Schicht 105 aus
Nickel und die erste Schicht 104 aus PdCl₂ elektrisch zu

kontaktieren.

Es ist anzumerken, dass für die Beschaffenheit der zweiten Schicht mit katalytisch aktivem Metall alle Metalle möglich sind, die im Stande sind, den Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren zu katalysieren und die sich mittels eines elektrolosen Abscheideverfahrens abscheiden lassen.

11

In diesem Dokument sind folgende Veröffentlichungen zitiert:

- [1] EP 1 061 041 A1
- 5 [2] EP 1 061 544 A1
 - [3] US 5,973,444 A
 - [4] US 6,062,931 A

10

[5] US 5,726,524

Bezugszeichenliste

1	0.0	Substrat
- 1	u	Substrat

- 101 Dielektrikumschicht
- 102 Leiterbahn aus Metall 1 (zu kontaktierende Unterlage eines mikroelektronischen Schaltkreises)
- 103 Oxid des Metalls 1
- 104 Primerschicht
- 105 katalytisches Metall 2
- 106 Kohlenstoff-Nanoröhren, gewachsen auf dem katalytischen Metall 2
- 107 Ausschnitt eines mikroelektronischen Schaltkreises

Ansprüche

10

- 1. Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb einer elektrisch zu kontaktierenden Unterlage
- bei dem zumindest ein für den Wachstum von Kohlenstoff-Nanoröhren katalytisch aktives Metall oberhalb der elektrisch zu kontaktierenden Unterlage mittels eines elektrolosen Abscheideverfahrens aufgebracht wird, und
 - bei dem Kohlenstoff-Nanoröhren auf dem katalytisch aktiven Metall gewachsen werden.
 - 2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
 - bei dem eine erste Schicht direkt auf die elektrisch zu kontaktierende Unterlage abgeschieden wird und
- bei dem eine zweite Schicht mit dem katalytisch aktiven Metall direkt auf die erste Schicht abgeschieden wird.
 - 3. Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die erste Schicht Metallatome aufweist.
 - 4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem das Wachsen der Kohlenstoff-Nanoröhren mittels eines Abscheideverfahrens aus der Gasphase erfolgt.
- 25 5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die elektrisch zu kontaktierende Unterlage eine Leiterbahn eines mikroelektronischen Schaltkreises ist.
 - 6. Verfahren gemäß Anspruch 5,
- 30 bei dem die Leiterbahn Kupfer oder Aluminium aufweist.
 - 7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 bis 6,

bei dem vor dem Aufbringen der ersten Schicht direkt auf die elektrisch zu kontaktierende Unterlage eventuell vorhandenes Metalloxid auf der Oberfläche der elektrisch zu kontaktierenden Unterlage entfernt wird.

5

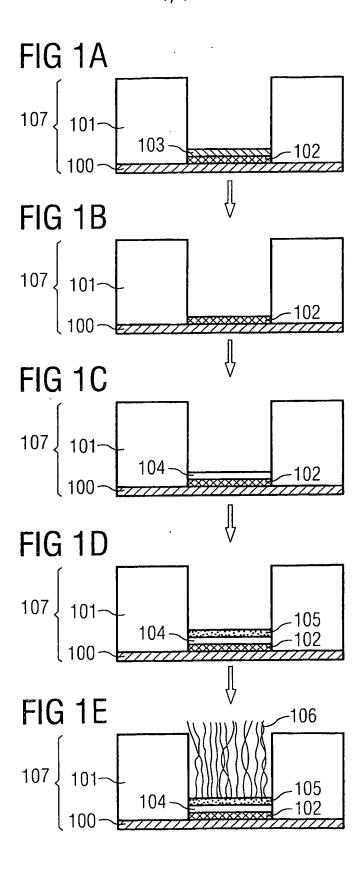
8. Verfahren gemäß Anspruch 7,

bei dem das Entfernen des Metalloxids durch Behandeln der Oberfläche der elektrisch zu kontaktierenden Unterlage mit Wasserstoffplasma oder mit Säure erfolgt.

- 9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 bis 8, bei dem die erste Schicht aus PdCl₂ besteht.
- 10. Verfahren gemäß Anspruch 9,
- 15 bei dem die erste Schicht PdCl2 aufgebracht wird, indem
 - eine wässrige Lösung mit
 - o etwa 0.25 g/l bis etwa 12.5 g/l PdCl₂,
 - o etwa 0,25 bis etwa 12,5 vol.% 36% HCl und
 - o etwa 0-20 vol.% Glyzerin/EtOH
- 20 in Kontakt mit der elektrisch zu kontaktierenden Unterlage gebracht wird und
 - anschließend mit 10 vol.% HCl gespült wird.
 - 11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 oder 10,
- 25 bei dem die zweite Metallschicht aus Nickel besteht.
 - 12. Verfahren gemäß Anspruch 11, bei dem die zweite Metallschicht aus Nickel aufgebracht wird, indem
- 30 eine wäßrige Lösung mit
 - o etwa 45 g/l NiCl2,
 - o etwa 11 g/l NaOCl,
 - o etwa 100 g/l Natriumzitrat und

o etwa 50 g/l Ammoniumchlorid in Kontakt mit der ersten Schicht gebracht wird und anschließend mit $\rm H_2O$ gespült wird.

5 13. Bauelement, das Kohlenstoff-Nanoröhren aufweist, die gemäß einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 gewachsen wurden.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ernational Application No rCT/DE 02/00194

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C23C16/26 C23C16/02 C01B31/02	2 H01L21/3205	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ion and IPC	
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)	
IPC 7	C23C C01B H01L	,	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search terms used)	
INSPEC	, COMPENDEX, EPO-Internal, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the reter	vant passages	Relevant to daim No.
х	US 6 146 227 A (MANCEVSKI VLADIMI 14 November 2000 (2000-11-14)	R)	1,4,13
Α	column 3. line 12 - line 49; figur	re 1	11,12
	column 8, line 35 - line 52		
Α	EP 1 061 544 A (ILJIN NANOTECH CO	LTD ;JIN	1-13
	JANG (KR)) 20 December 2000 (2000 cited in the application	-12-20)	
	column 5, line 5-20; claims 7-17		
Α	US 6 129 901 A (LI JING ET AL)		1-13
^	10 October 2000 (2000-10-10)		
	column 3, line 18 -column 4, line	43	
	-	/	:
X Furl	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
° Special ca	alegories of cited documents :	T* later document published after the inte	rnational filing date
A docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but
	document but published on or after the international	X* document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	be considered to
L docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do 'Y' document of particular relevance; the o	cument is taken alone claimed invention
"O" docum	n or other special reason (as specmed) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in document is combined with one or mo ments, such combination being obvious	ventive step when the ore other such docu-
'P' docum	means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. '&' document member of the same patent	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	
2	9 May 2002	11/06/2002	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Patterson, A	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ernational Application No rCT/DE 02/00194

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	neievalli to claim no.		
Ρ, Χ	VAJTAI R ET AL: "Carbon nanotube network growth on palladium seeds" CURRENT TRENDS IN NANOTECHNOLOGIES: FROM MATERIALS TO SYSTEMS. SYMPOSIUM S, EMRS SPRING MEETING 2001, STRASBOURG, FRANCE, 5-8 JUNE 2001, vol. C19, no. 1-2, 2 January 2002 (2002-01-02), pages 271-274, XP002200555 Materials Science & Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems, 2 Jan. 2002, Elsevier, Netherlands ISSN: 0928-4931 the whole document	1,4,13		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

nternational Application No PCT/DE 02/00194

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6146227	Α	14-11-2000	AU EP WO	6267299 A 1135792 A1 0019494 A1	17-04-2000 26-09-2001 06-04-2000
EP 1061544	A	20-12-2000	CN EP JP	1278104 A 1061544 A1 2001023508 A	27-12-2000 20-12-2000 26-01-2001
US 6129901	A	10-10-2000	AU CA WO	1220799 A 2310065 A1 9925652 A1	07-06-1999 27-05-1999 27-05-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

'-ternationales Aktenzeichen
PCT/DE 02/00194

klassifizierung des anmeldungsgegenstandes PK 7 C23C16/26 C23C16/02 H01L21/3205 C01B31/02 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C23C C01B H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete tallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) INSPEC, COMPENDEX, EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. 1,4,13 US 6 146 227 A (MANCEVSKI VLADIMIR) X 14. November 2000 (2000-11-14) Spalte 3, Zeile 12 - Zeile 49; Abbildung 1 Spalte 8, Zeile 35 - Zeile 52 11,12 Α 1 - 13EP 1 061 544 A (ILJIN NANOTECH CO LTD ;JIN Α JANG (KR)) 20. Dezember 2000 (2000-12-20) in der Anmeldung erwähnt Spalte 5, Zeile 5-20; Ansprüche 7-17 1 - 13US 6 129 901 A (LI JING ET AL) Α 10. Oktober 2000 (2000-10-10) Spalte 3, Zeile 18 -Spalte 4, Zeile 43 Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen "7" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L* Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) Overöffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 11/06/2002 29. Mai 2002 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Patterson, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nternationales Aktenzeichen
PCT/DE 02/00194

		PC1/DE 02/0			
C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teite Be	tr. Anspruch Nr.		
C.(Fortsetz Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen VAJTAI R ET AL: "Carbon nanotube network growth on palladium seeds" CURRENT TRENDS IN NANOTECHNOLOGIES: FROM MATERIALS TO SYSTEMS. SYMPOSIUM S, EMRS SPRING MEETING 2001, STRASBOURG, FRANCE, 5-8 JUNE 2001, Bd. C19, Nr. 1-2, 2. Januar 2002 (2002-01-02), Seiten 271-274, XP002200555 Materials Science & Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems, 2 Jan. 2002, Elsevier, Netherlands ISSN: 0928-4931 das ganze Dokument	den Teite Be	tr. Anspruch Nr. 1,4,13		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Ver

rungen, die zur selben Patentfamilie gehören

emationales Aktenzeichen
PCT/DE 02/00194

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6146227	A	14-11-2000	AU EP	6267299 A 1135792 A1	17-04-2000 26-09-2001
			WO	0019494 A1	06-04-2000
FP 1061544		20-12-2000	CN	1278104 A	27-12-2000
2. 1001011	••		EP	1061544 A1	20-12-2000
			JP	2001023508 A	26-01-2001
US 6129901	Α	10-10-2000	AU	1220799 A	07-06-1999
05 0129901	,,	22 20 2000	CA	2310065 A1	27-05-1999
			WO	9925652 A1	27-05-1999

METHOD FOR GROWING CARBON NANOTUBES ABOVE A BASE THAT IS TO BE ELECTRICALLY CONTACTED AND A COMPONENT

Publication number: WO02059392

Publication date:

2002-08-01

Inventor:

KREUPL FRANZ (DE); HOENLEIN WOLFGANG (DE)

Applicant:

INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE); KREUPL FRANZ

(DE); HOENLEIN WOLFGANG (DE)

Classification:

- international:

C01B31/02; C23C16/02; C23C16/26; H01L21/288; H01L21/3205; H01L21/768; H01L23/522; C01B31/00; C23C16/02; C23C16/26; H01L21/02; H01L21/70; H01L23/52; (IPC1-7): C23C16/26; C01B31/02;

C23C16/02; H01L21/3205

- european:

C01B31/02B; C23C16/02H2; C23C16/26; H01L21/288;

H01L21/3205P; H01L21/768C3; H01L21/768C4B;

H01L23/522E; Y01N6/00

Application number: WO2002DE00194 20020122
Priority number(s): DE20011003340 20010125

Also published as:

DE10103340 (A:

Cited documents:

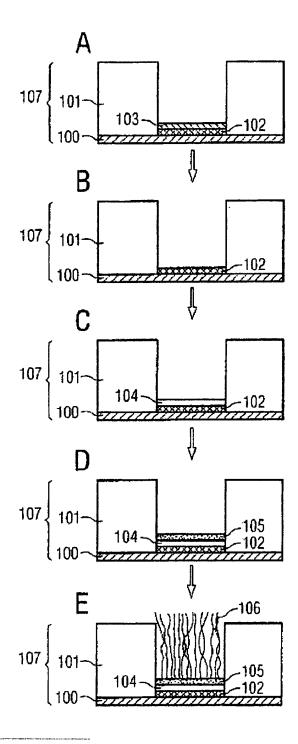
US6146227 EP1061544 US6129901 XP002200555

Report a data error he

Abstract of WO02059392

The invention relates to a method for growing carbon nanotubes above a base that is to be electrically contacted. According to said method, at least one metal, which is catalytically active in the growth of carbon nanotubes is applied above the predetermined area of the base that is to be contacted, by means of an electrodeless deposition method and carbon nanotubes are grown on the catalytically active metal.

2006-10-02 18:53



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide